

最近公開された出願特許

2011年10月1日～2012年9月30日

- | | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| 特開2012-184449 | 金属薄膜の製膜方法、金属薄膜、および金属薄膜の製膜装置 | 特開2012-061447 | CO ₂ の分離回収方法及びCO ₂ の分離回収装置 |
| 特開2012-182373 | 炭化珪素除去装置、及び炭化珪素の除去方法 | 特開2012-060957 | ガス供給方法及びガス供給装置 |
| 特開2012-181126 | 酸素濃度の分析方法及び装置 | 特開2012-051753 | ガスの精製方法およびガス精製装置 |
| 特開2012-181092 | 加熱濃縮装置、及び加熱濃縮方法 | 特開2012-049413 | 超電導部材冷却装置、及び断熱容器内のサブクール液体窒素の温度維持方法 |
| 特開2012-178488 | サセプタカバー、該サセプタカバーを備えた気相成長装置 | 特開2012-047350 | 冷凍液化機及び冷凍液化機の運転方法 |
| 特開2012-177663 | 予備凍結器 | 特開2012-046359 | 熱処理雰囲気ガス発生方法及び装置並びに金属酸化物の熱処理方法 |
| 特開2012-176879 | 水素製造装置 | 特開2012-042079 | 空気液化分離装置及びその運転方法 |
| 特開2012-174731 | 気相成長方法、及び気相成長方法により形成された化合物半導体膜 | 特開2012-032126 | 熱交換型蒸留装置 |
| 特開2012-170916 | 光化学反応装置、及び光化学反応装置を用いた同位体濃縮方法 | 特開2012-031559 | 酸化処理方法及び酸化処理装置 |
| 特開2012-169408 | マスク用材料、マスクの形成方法、パターン形成方法、及びエッチング保護膜 | 特開2012-026580 | 高压ガス供給方法 |
| 特開2012-169362 | シリコン窒化膜の形成方法 | 特開2012-015260 | F R P製クライオスタット |
| 特開2012-166991 | 原料ガス拡散抑制型カーボンナノ構造物製造装置 | 特開2012-013258 | バーナの燃焼方法 |
| 特開2012-166988 | C N T製造用の四層型触媒基体、基板炭化層付きC N T、炭化層付きC N T、C N T製法、C N T回収方法及びC N T連続製造装置 | 特開2012-007990 | 液面計及び液面高さの測定方法、並びに精留塔及び精留塔の運転方法 |
| 特開2012-163540 | ガス測定装置、及び水素化物ガスの測定方法 | 特開2012-007785 | 無機質球状化粒子製造用バーナ、無機質球状化粒子製造装置、及び無機質球状化粒子の製造方法 |
| 特開2012-163183 | 低温液化ガス供給方法及び低温液化ガス浸漬装置 | 特開2011-243053 | 帳票判別装置、帳票分類システム、帳票判別方法および帳票判別プログラム |
| 特開2012-163129 | 低温液化ガス移送装置 | 特開2011-230037 | 残存ガスの回収方法 |
| 特開2012-162752 | 気相成長装置 | 特開2011-230036 | 気体分離装置の運転方法 |
| 特開2012-161775 | 膜エレメント及びその製造方法、並びに膜モジュール | 特開2011-230035 | ガス分離方法 |
| 特開2012-160647 | シリコン窒化膜の形成方法 | 特開2011-224426 | 酸素同位体の濃縮方法および酸素同位体の濃縮装置 |
| 特開2012-156355 | プラズマC V D成膜装置のクリーニング方法 | 特開2011-222739 | 気相成長装置 |
| 特開2012-154561 | バーナの燃焼方法 | 特開2011-218412 | マグ溶接用シールドガス、マグ溶接方法、および溶接構造物 |
| 特開2012-153583 | セレン化水素製造装置 | 特開2011-212610 | 酸素同位体の濃縮方法 |
| 特開2012-153581 | セラミックスとアルミニウムとの接合方法 | 特開2011-210881 | 炭窒化珪素膜及び炭窒化珪素膜の成膜方法 |
| 特開2012-132781 | ガスクロマトグラフィーを用いた分析方法、及びガスクロマトグラフィーを用いた分析装置 | 特開2011-208712 | 圧縮ガス充填方法、及び圧縮ガス充填装置 |
| 特開2012-132607 | 熱処理炉及び熱処理炉の運転方法 | 特開2011-208672 | 希少ガス回収装置用の安全装置 |
| 特開2012-117926 | 同位体濃度の分析方法 | 特開2011-208187 | 金属超微粉の製造方法 |
| 特開2012-114150 | F R P製クライオスタット | 特開2011-207724 | ロープ状炭素構造物製造用配向カーボンナノチューブ、ロープ状炭素構造物及びその製法 |
| 特開2012-112521 | 液化ガス供給装置及び方法 | 特開2011-206681 | 液分配器 |
| 特開2012-107828 | 無機質球状化粒子製造用バーナ、無機質球状化粒子製造装置、及び無機質球状化粒子の製造方法 | 特開2011-202765 | ガス遮断弁装置 |
| 特開2012-096285 | 溶融金属処理剤及び溶融金属処理方法 | 特開2011-202685 | 高压ガスの定量供給装置および定量供給方法 |
| 特開2012-094903 | クリーニング方法、半導体装置の製造方法及び基板処理装置 | 特開2011-202191 | 導電性フルオロカーボン薄膜の形成方法 |
| 特開2012-083058 | 空気液化分離方法及び装置 | 特開2011-201809 | アセチレンの製造装置及び製造方法 |
| 特開2012-083045 | バーナの燃焼方法 | 特開2011-200923 | プラズマアーク溶接方法 |
| 特開2012-081480 | 溶接ガス及びプラズマ溶接方法 | 特開2011-198563 | プラズマディスプレイパネル用放電ガスおよびプラズマディスプレイパネル |
| 特開2012-077780 | ガスボンベ | 特開2011-195386 | ガラス溶解炉およびガラス溶解炉における排ガスの処理方法 |
| 特開2012-076071 | オゾン混合物の分解排出方法、及びオゾン混合物の分解排出装置 | 特開2011-194380 | 金属不純物の除去方法 |
| 特開2012-074651 | 半導体装置、及び、その製造方法 | 再表2010/090038 | 絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜 |
| 特開2012-072094 | 重水素化されたイミダゾール誘導体の製造方法 | 再表2010/064651 | ガス供給方法 |

以上 76件